論 文

AI-1.03 mass%Si 合金における高温変形挙動と Si 析出粒子の Ostwald 成長

吕 満 珊,* 後 藤 正 治,** 麻 生 節 夫,** 小 松 芳 成,** 劉 武*

Ostwald Growth of Si Precipitates and Elevated Temperature Deformation in Al-1.03 mass%Si Alloy

by

Manshan Lu[†], Shoji Goto^{††}, Setuo Aso^{††}, Yoshinari Komatsu^{††} and Wu Liu[†]

ABSTRACT

The coarsening behavior of Si precipitates for over-aging stage was observed in Al-1.03 mass%Si alloy. The coarsening data were agreement with Lifshiz-Wagner theory on diffusion-controlled coarsening. The influence of this Ostwald growth of Si precipitates on elevated temperature deformation in this alloy was studied at temperatures from 473K to 623K in air and at initial strain rates from 7.94×10^{-5} to $1.76 \times 10^{-2} \, \text{s}^{-1}$. It was showed that the steady state flow stress is decreased with the Ostwald growth of Si precipitates. TEM observation revealed that the interaction between dislocations and Si precipitates is of attractiveinteraction type, indicating that the stress field of a dislocation is relaxed at the Si precipitates.

Key Worde: Al-Si alloy, Ostwald growth, dislocation, elevated temperature deformation, yield stress, precipitation-hardening, attractive interaction, void-hardening.

平成9年3月24日受付

- *秋田大学大学院鉱山学研究科博士後期課程機能物質工学専攻 〒010 秋田市手形学園町1−1 ☎0188-89-2418
- **秋田大学鉱山学部物質工学科 〒010秋田市手形学園町1-1
 - † Graduate student, Graduate school of Mining and Engineering, Akita University, 1—1 Tegata Gakuencho, Akita 010, Japan.
- † † Department of Materials Engineering and Applied Chemistry, Mining College, Akita University, 1—1 Tegata Gakuencho, Akita 010, Japan.

1. 緒 言

金属材料の高温強度向上のために、従来熱的に安定 な粒子を含む粒子分散強化合金に関しては、高温変形 に対するいろいろな基礎的立場からの研究が行われ て^{いのの},実験結果に基づく経験式もすでに確立されて いる。しかし、実用材料には時効析出型の合金を用い る場合が多く、この場合析出粒子は熱的に不安定で、 高温使用中に中間相から安定相に変化したり、あるい は Ostwald 成長を伴って粗大化するため、力学的性 80

呂 満珊・後藤正治・麻生節夫・小松芳成・劉 武

case composition of the aney							
Si	Fe	Ti	Cu	Mg	Mn	Al	
(mass%)	(ppm)	(ppm)	(ppm)	(ppm)	(ppm)	(mass%)	
1.03	966	34.5	46.8	30.1	12.1	bal.	

Table 1 Chemical composition of the alloy

質の劣化を生ずることが多く問題となっている。した がって,実際面では熱的に安定な粒子ではなく,熱的 に不安定な粒子を含む析出型合金の高温変形挙動を明 らかにしておくことが材料開発の点で基本的に重要な ことである。

ところで、Al-Si 合金に関する従来の研究によれば、 複雑な析出過程はなく、 時効初期からダイヤモンド構 造を有する硬い Si 粒子が析出し、その後、母相のSi濃 度は平衡値に近づき, Si 析出粒子の総体積はほぼ一定 となる、いわゆる一段硬化挙動を示すことが知られて いる⁴。この時効段階では Ostwald 成長によって、よ り大きな析出粒子が小さな析出粒子をくって更に大き なものへと成長する。この析出物は比較的性質の明ら かな Si 単体である。したがって、析出型合金の高温 変形挙動におよぼす Ostwald 成長の影響などを研究 するには、Al-Si 合金は非常に適したものであると考 えられる。今まで Al-Si 合金の研究では Ostwald 成 長に伴う粒子の平均半径の時間変化や粒子半径の分布 曲線などの基礎的実験®は行われて来ているが、変形 に関する研究は少なく,根本ら⁶⁰⁰が Al-1.42wt%Si 合金の室温変形において転位と析出粒子の相互作用を 観察して, Orowan の by-pass 機構について明らかに したのみである。しかしながら、この合金の高温変形 挙動や変形機構に関してはまだ明らかにされておらず、 特に高温変形に対する Si 粒子の Ostwald 成長の影響 については全く研究が行われていない。

そこで本研究では Al-Si 合金の時効析出過程におけ る, Si 粒子の Ostwald 成長と高温変形挙動との関連 性を明らかにするとともに,高温における Si 粒子と 転位との相互作用を透過電子顕微鏡による直接観察を 行うことによって,高温変形機構についても明らかに することによって,熱的に不安定な析出粒子を含む合 金の高温変形挙動の予測のための基礎的知見を得るこ とを目的とした。

2. 試料および実験方法

1 試料作製と熱処理

純Alと金属Siを大気中溶解して、20wt%Si 母合 金を作製した。その後この母合金と純Alを大気中溶 解して、35×91×146mm形状のAl-1.03mass%Si 合 金インゴットを作製した。そのインゴットを843Kで 75時間の均質化焼鈍を行った。これを4等分したのち 573Kで熱間圧延加工によって、6×51×370mmの板 材を作製した。合金の化学成分はTable 1の通りであ る。次にこの板材を切削加工することによって、軸方 向が圧延方向に平行で、長さ10mm、直径4mmの円 柱状圧縮試験片とした。これらの試験片を833Kで3 時間の溶体化後0℃の氷水中に焼入れ、初期時効条件 を等しくし、かつ時効初期に球状に近い微細析出粒子 を形成させるために急冷後0℃の氷水中で1時間の予 備時効をした[®]。その後473Kで200hrまでの時効処理 を行って、時効処理試験片とした。

2.2 高温圧縮試験

時効処理試験片の変形には Instron 型万能試験機を 用いて,大気中473Kから623Kまでの温度範囲および 7.94×10⁻⁵S⁻¹から1.76×10⁻²S⁻¹の初期ひずみ速度範 囲で圧縮試験を行った。応力一ひずみ曲線の形状を検 討するとともに,得られた応力一ひずみ曲線から定常 変形応力(応力一ひずみ曲線で変形応力がひずみにほ とんど依存しなくなる応力)とひずみ速度の関係を求 めた。さらに比例限界の応力を降伏応力として決め, これを測定した。試験片の加熱には,抵抗加熱炉を用 い,かつ P. I. D. 方式によって温度制御した。試験中 の温度変動は設定温度に対して±2.0K の精度であっ た。また,各試験温度での変形組織をできるだけ安定 に保持するために,試験機から取出した試験片は試験 後ただちに氷水中に焼入れた。

2.3 電子顕微鏡観察

粒子のオストワルド成長を確認するため,Si析出粒 子観察用の薄膜試料は,473K で各時間時効処理した 円柱状試験片の断面を切断して,厚さ0.5mmの円板 を作製し,エメリー紙およびバフで研摩した後, 273Kに保持した過塩素酸-エチルアルコール1:4混 合溶液を用いてツインジェット電解研摩法によって作 第10巻 第1号 (1997)

製した。また,転位と析出粒子の相互作用の様子を観察するために圧縮変形した試験片から電子顕微鏡観察 用の薄膜試料を作製した。観察にはJEM-2010型電子 顕微鏡を用いて,加速電圧200KVで行った。転位と 粒子のコントラストを常に最良の状態に保つために試 料二軸傾斜ホルダーを用いた。

3. 実験結果および考察

3.1 応力一ひずみ曲線

Fig. 1~Fig. 4 は各温度および各初期ひずみ速度で の圧縮試験で得られた応力—ひずみ曲線について調べ た結果である。Fig. 1 は473K/11hr 時効処理した合 金に対するもの, Fig. 2 は473K/30hr 時効処理した 合金に対するもの Fig. 3 は473K/100hr 時効処理し た合金に対するもの, また Fig. 4 は473K/200hr 時 効処理した合金に対するものである。いずれの応力— ひずみ曲線においても直線的に応力が増加する弾性変 形域から加工硬化を伴う塑性変形域までを示している。 しかし, ひずみ量が約12%以上になるといずれの温度 やひずみ速度においても定常変形状態域に入ることが わかる。また同一圧縮試験温度ではひずみ速度が減少 するほど応力レベルが低下し、かつ同一ひずみ速度で は変形温度が上昇するほど応力レベルが低下すること がわかる。このことは後にも述べるように、変形によっ て導入された転位の密度増加による加工硬化と変形中 に回復によって生ずる転位密度減少による軟化および Ostwald 成長による Si 粒子の粗大化再分散が主な原 因になっているものと考えられる。特に温度573K 以 上での低ひずみ速度では変形初期に明瞭な高温降伏現 象が見られるが、高ひずみ速度では定常変形状態に入 る前に大きく加工硬化していることがわかる。次にこ れらの曲線から得られる降伏応力と定常変形応力の挙 動について検討することにする。

3.2 降伏応力



Fig. 1 True stress-true strain curves at various strain rates and temperatures for the alloy aged at 473K for 11hr

Akita University

民 満珊・後藤正治・麻生節夫・小松芳成・劉 武



Fig. 2 True stress-true strain curves at various strain rates and temperatures for the alloy aged at 473K for 30hr



Fig. 3 True stress-true strain curves at various strain rates and temperatures for the alloy aged at 473K for 100hr

82

kita University

第1号(1997) Al-1.03mass%Si 合金における高温変形革動と 第10巻 Si 析出粒子の Ostwald 成長 (a) 473K έ ≈1.63×10-2s-1 (b) 523K 4 04×10 -34-3 125 125 €=1.63×10 -2s-1 E =4.11×10 -33-1 100 100 -A 31 × 10 -5 -1 e =4.16×10 -4s-1 J/MPa 75 75 E=8.27×10-55-1 $\dot{e} = 4.11 \times 10^{-1}$ £ =8 05 × 10 4 50 50 25 25 (c) 573K (d) 623K 125 124 100 ė ≈4.17×10 -3s-1 100 e =1.65×10-25-1 o /MPa 75 75 € =1.64×10-2s-1 e=4.13×10 -3s-1 50 E =8.29×10-5s £ =8.31×10 =4.02×10 -4 s -1 25 25 =7 94×10 -5 E 1% E1% 10%

Fig. 4 True stress-true strain curves at various strain rates and temperatures for the alloy aged at 473K for 200hr

ついて検討することとした。しきい応力の求め方には クリープ試験法や引張試験法などいろいろの方法が提 案されているが、吉田ら®によれば、分散強化合金の 高温変形のしきい応力測定法の一つとして, 引張試験 によって得られた応力--ひずみ曲線の形状を解析すれ ば、このときの比例限界の応力すなわち、降伏応力値 がしきい応力とほぼ一致することを報告している。本 実験においても吉田ら⁸の方法に従って、圧縮試験で 得られた応力―ひずみ曲線の比例限界応力を降伏応力, すなわちしきい応力として測定した。Fig.5 は473K で各時間時効処理した試料を室温(RT), 523K, 573 K および623K で圧縮試験したものの降伏応力の値を それぞれ (a), (b), (c) および (d) の曲線として示 した。各曲線は473Kにおける時効処理時間に対して 中間にピークを有する単純な一段時効硬化曲線の形態 を呈している。このことからも本合金は時効初期に微 細 Si 粒子が単体で析出し、粒子径の増大は見られな いが
⁹、数密度の
増加を
伴った
初期時
効
段階を
経てピー ク位置を示した後に Si 粒子同志の Ostwald 成長によっ て、粒子径は増大し、数密度は減少するいわゆる過時 効段階を経て軟化するものであることが推察できる。



Fig. 5 The change in yield stress pressed at various temperature with time aged at 473K

圧縮温度の増加とともに、応力レベルおよびピーク値 ともに低下するのは圧縮温度が本試験片の最初の時効 処理温度よりも高温であるために、それらの温度で圧 縮試験を行っている過程ですでに Ostwald 成長が進 行し、473K での時効状態が一層加速されたことによ るもの(ピーク以後)と考えられる。なお、523~623 K における圧縮の場合約100hr のピーク値を示す時効 時間まではそれぞれの温度でのピーク値より低い値を 示しているが,これはそれらの温度では Si 粒子のサ イズが小さすぎて,まだ初期時効段階に相当していた ことや復元現象にもとずく一部粒子の再固溶による軟 化によるものであろう。いずれにしても,ピーク値以 後は析出粒子の体積分率が一定のもとで粒子同志のく い合いがおこり,Ostwald 成長に帰因する過時効の 効果によって降伏応力,すなわちしきい応力が低下し てゆくものと推察される。

以上のように熱的に不安定な粒子を含む析出硬化型 合金の場合は、変形に対するしきい応力の値が分散粒 子の析出状態によって、様々に変化し得ることが明ら かとなった。このことは材料の実用面においても大変 注目すべきことである。

3.3 定常変形状態における応力とひずみ速度の関係

3. 3. 1 変形温度依存性

473K で時効処理した合金に対して, 種々の温度に おけるひずみ速度 ϵ を定常変形応力 σ の両対数でプロッ トした一例を Fig. 6 に示す。なお、この図には473K で11hr 時効処理後473~623K で圧縮試験を行った時 の定常変形応力のみを示し、その他の時効処理時間 (30hr, 100hr, 200hr) での結果もほぼ同様の傾向を示 したのでここではそれらを省略した。また比較のため



 σ /MPa

Fig. 6 The relation between stress and strain rate for the steady-state deformation

に純 Al 試験片に対する結果も示した。さらに, 前述 の比例限界応力σyをしきい応力として見なし、ひず み速度がほとんど無視できるほどの変形速度, すなわ ち ε =1.0×10⁻⁷ s⁻¹の位置にプロットして示した。図 から明らかなように,比例限応力σvが変形温度に強 く依存していることが見られる。ところで, 葉英華 ら¹⁾によると分散強化 Al-1.5 vol%Be 合金の高温変形 におけるしきい応力は変形温度には依存しないことが 報告されており、本実験の結果と大きな違いを示して いる。このことは前節でも述べたように本実験で用い た試料は熱的に不安定な析出粒子を含むからである。 このことは著者らが前報¹⁰で提案したモデルを用い て得られた結果, すなわち, 熱的に不安定な粒子を含 む合金の場合はしきい応力が変形温度に強く依存する が、安定な粒子である場合はしきい応力は変形温度に 依存しないということを実験的に証明したものである。 Fig. 6に示している測定点はそれぞれの高応力域で 直線関係が成り立ち,その直線の勾配すなわち応力指 数は変形温度の増加とともに幾分小さくなる傾向が認 められるようである。なお、比較のため純 Al に対し て測定した結果も同図に併記した。純 Al と Al-1.03 %Si 合金の場合を比べると、変形温度が高いほど、ま た応力が低下するほど、両者間の差が大きくなって常 に Al-1.03%Si 合金の方が高応力側に位置しており、 いずれの温度においても析出粒子強化の効果が顕著に 現れていることがわかる。

3.3.2 Si 析出物粒子のパラメーター依存性

Al-1.03mass%Si 合金においては転位は Si 析出粒 子によって運動を阻止されるので,そのことによって, 合金の強度は高くなる。したがって,Si 析出粒子の分 散パラメーターが高温変形中にどのように変化するの かを明らかにすることは合金の高温強度を論じる上で 重要な問題である。前節で述べたように Fig.5 によ り,473K で時効処理した合金を473~623K の温度範 囲で変形すれば降伏強度のピーク位置が約70hr~100h r時間範囲に現れている。その後の時間に対しては析 出粒子が Ostwald 成長すると考えられる。この場合, 定常変形応力とひずみ速度の関係がどのように変化す るのかを解明するために,473K で各時間時効処理し た合金を種々の温度で圧縮変形して,そのときの定常 変形応力とひずみ速度の関係を求めて Fig.7 示した。 図中の記号は473Kで時効処理した時間を示す(たと kita University



Fig. 7 Effect of Ostwald growth on the relation between strain rate and steady-state stress for (a) 473K (b) 523K (c) 573K and (d) 623K

えば r100h は473K で100hr 時効処理を Si 粒子を成長分 散させた合金を各温度で圧縮変形したものである) す なわち, r100h からr500h になるほど Si 粒子は粗大分散し ている。これらの図を見ると, いずれとも Si 析出物 粒子の大きさが増加するとともに, 定常変形応力が減 少することが見られる。すなわち, また圧縮試験温度 が上昇するほど((a) から(d) へ)応力値は低応力レ ベル側に移動し,高温変形中にも Ostwald 成長を伴っ た強度低下が進行していることを示している。この原 因を調べると, Ostwald 成長して析出粒子の粗大化 にともなって, 析出粒子の数密度は減少し, 平均粒子

間距離が増加するので, Si 析出粒子強化の効果が弱く なるものと考えられる。このことは宮川ら¹¹⁰ によって も報告されているように,分散パラメータが小さい方 が分散粒子による強化が大きいということと同じ傾向 である。

3. 4 Ostwald 成長の観察

前節においては高温における定常変形応力の変化や しきい応力の温度依存性などは、すべて本合金におけ る Si 析出粒子の Ostwald 成長に帰因するものである として議論を進めて来た。しかし、本合金において実 際に Ostwald 成長が生じているか否を実証する必要 86



Fig. 8 TEM photograph of Si precipitates in alloy

(a) aged at 473K for 11 hr, $\bar{r}_{a} = 4.30 \times 10^{-7}$ cm, (b) aged at 473K for 30 hr, $\bar{r}_{b} = 5.50 \times 10^{-7}$ cm, (c) aged at 473K for 100 hr, $\bar{r}_{c} = 4.30 \times 10^{-7}$ cm, (d) aged at 473K for 200 hr, $\bar{r}_{d} = 4.30 \times 10^{-6}$ cm.

がある。そこで本節ではこの点について検討すること にした。Fig. 8は473K で時効処理した合金の Si 析出 粒子の透過電子顕微鏡写真である。(a)は、11時間で 時効したもの、(b)は30時間で時効したもの、(c)は 100時間で時効したもの、また(d)は200時間で時効 したものである。いずれの場合も Si 析出粒子はほぼ 球状であることが確認された。Lifshiz-Wagnerの理 論によれば, Ostwald 成長が拡散律速で起こる場合 には、時効処理時間 t に対する析出物粒子の平均半径 rの依存性は $\bar{r}^{3} = \bar{r}^{3}_{0} + kt$ で与えられる。ここで、k = $8\sigma DCVm/9RT, \sigma$ は析出粒子と母相の間の界面の 界面自由エネルギー, D は母相中での溶質原子の拡散 係数, Vm は析出物粒子のモル体積, R は気体定数お よび T は温度であり、 ro は Ostwald 成長が始まる時 点での析出粒子の平均半径である。TEM 写真から Si 析出粒子の平均半径を測定した結果を Fig. 9 に示し



Fig. 9 The change of mean radius of Si precipitates aged at 473K

た。本測定を行うにあたって統計的に意味のある結果 を得るために、各時効条件に対して三つの視野写真か ら合計200~300個もの多数の析出粒子について測定を 行った。この結果を見ると、Si 析出粒子は時効時間に ともなって大くなること、すなわち Ostwald 成長し ていることが明瞭になった。また Si 析出粒子の平均 半径 r の時効時間依存性はほぼ Lifshiz-Wagner 理論 にしたがって $t^{1/3}$ になることがわかる。

3.5 転位とSi析出粒子の相互作用

粒子分散強化型合金の高温強度や高温変形機構を解 析するためには、変形を担う転位とそれに対して障害 となる分散粒子との相互作用について正しく理解して おくことが必要である。そこで本節では本合金におけ る高温変形において Si 析出粒子による強化機構を解 析するために、電子顕微鏡を用いて転位と Si 析出粒 子との相互作用のその場観察を行った。その結果を Fig. 10 に示す。この写真は473K で100hr 時効処理後 の合金を573K, 8.31×10⁻⁵ S⁻¹の条件で圧縮変形させ

た試料の高温変形組織である。なお、同一試料におい ても種々の相互作用が観察されたので、代表的な4つ の視野((a) \sim (d))についての観察結果を示した。 Schroder と Arzt¹² は不整合界面を有する分散粒子と 転位が吸引的な相互作用をすることを観察している。 本研究で用いた Al-1.03mass%Si 合金中の Si 析出粒 子はダイヤモンドの構造を有し,fcc 構造の Al 母相 との間に不整合界面が存在するものと思われる。した がって、本合金における転位と粒子が高温で吸引的な 相互作用をするものと推察される。Fig. 10(a) にお いて矢印の位置に注目すると、①番は転位が粒子に到 達する直前の状態である。②番で粒子に引きつけられ ていた転位は、写真の下の方に向かって張り出してい る。③番は転位が粒子から離脱する直前の状態で、ま た④番は転位が粒子から離脱したところであると思わ れる。これらを見ると、転位は粒子に到達した側では なく粒子から離脱する側から張り出していることが推 察される。



Fig. 10 TEM photograph of interaction of dislocation with Si precipitates in the alloy compressed at 573K and 8.31 imes 10 $^{-5}$ S $^{-1}$

88

以上の推察と観察より、この場合の転位と Si 粒子 との相互作用は吸引型であると考えることができる。 同様の現象が写真(b),(c)および(d)においても 観察される。この高温特有の吸引型相互作用は転位の まわりの弾性的応力場が A1 母相と Si 粒子の不整合 界面で緩和されることによって生じるものと思われ る。Fig. 10(a)~(d)の写真にも観察されるよう に大部分の転位線は粒子から離れて独立に存在するこ とはなく、すべての転位は粒子に引っかかって、粒子 から直接抵抗を受けていることが見受けられた。とこ ろで一方、根本ら"は本実験のような高温ではなく、 室温で変形させた Al-Si 合金においては Si 粒子のま わりに転位ループが形成されることを確認しているが、 このような転位ループの形成は本実験の高温変形の場 合には見られなかった。したがって、Al-Si 合金にお ける室温変形では転位が析出物粒子のまわりにループ を残して進行する、いわゆる by-pass 機構に基づく Orowanの理論と一致するものと考えられるが、一 方,高温変形では転位は Si 粒子一母相界面に吸引さ れ、転位が Si 粒子から離脱するときに大きな抵抗を 生じ、これが本合金の強化機構を支配しているものと 推察される。この場合は粒子間に張り出す転位間距離 はOrowanの理論に基づくものよりも長くなるので、 Orowan 応力よりも低い応力で粒子の障害を通過す ることが可能であって、いわゆる Weeks ら¹⁰のボイ ド強化の理論と一致すると考えられる。

4. 結 論

Al-Si 析出型合金においては Si 析出粒子がマトリックス中で Ostwald 成長することにともなって高温変形強度がどのように変化するのか,さらにはその際の強化機構は何によって支配されているかについて解析するために、473K で種々の時間時効処理を施した Al-1.03mass%Si 合金について Ostwald 成長過程を調べ、かつ473~623K の温度範囲で $T.94 \times 10^{-5} \sim 1.76 \times 10^{-5}$ S⁻¹の初期ひずみ速度範囲で圧縮試験を行うとともに転位と Si 析出粒子との相互作用の観察を行って、以下の結論を得た。

1. 透過電子顕微鏡観察によって析出粒子のOstwald 成長過程を調べた。Si 析出粒子の平均半径の時 効時間依存性は Lifshiz-Wagner 理論にしたがって t^{1/3}に比例することを確認した。 2. 高温における定常変形状態での応力とひずみ速 度の両対数プロットにおいては高応力域では直線関係 が成り立ち,応力指数は変形温度の増加とともに幾分 小さくなる傾向がみられた。なお,温度が高いほど, かつ応力が低いほど,析出粒子分散強化の効果が顕著 にあらわれることが知られた。

3. 析出粒子の Ostwald 成長にともない,高温変 形におけるひずみ速度と定常変形応力の両対数関係曲 線は低応力側に向かって移動することが知られた。こ のことは,Ostwald 成長過程において析出粒子の数 密度が減少し,平均粒子間距離が増加することにより, 粒子の分散強化の効果が弱くなることによるものと推 論された。

4. 高温変形した合金の薄膜を透過電子顕微鏡によ り直接観察した結果,転位とSi析出粒子との相互作 用は吸引型であることが知られた。この高温特有の転 位と粒子の相互作用は転位の弾性的応力場がAl母相 とSi粒子の界面で緩和することによって生じるもの と考えられる。したがって,本合金の高温変形におい ては転位はボイド強化機構によって寄与していること が確認された。

謝辞

最後に,本研究の一部は1994年度 The British Council 財団, The Daiwa Anglo-Japanese Foundation, 1997年度科学研究費補助金基盤研究(c) および(財) 軽金属奨学会の教育研究資金によって行われたもので ある。また本論文をまとめるにあたり, Malcolm Mclean 教授 (Imperial College, Department of Materials, London) には有益な助言をいただいた。 ここに記して感謝の意を表する次第である。

参考文献

- 1)葉 英華,中島 英治,栗下 裕明,後藤 正治, 吉永日出男:日本金属学会誌.52 (1988), 1246.
- G.Gonzalez-Doncel, O.D.Sherby:Acta metall. mater., 41(1993), 2797.
- S.E.Broyles, K.R.Anderson, J.R.Groza and J.C.Gibeling : Metallurgical and Materials Transactions, 27A (1996), 1217.
- 4) 津田 大, 伊藤 太一郎, 中山 豊: 軽金属, 28 (1978), 15.

Akita University

第10巻 第1号 (1997) Al-1.03mass%Si 合金における高温変形挙動と Si 析出粒子の Ostwald 成長

- 5)田代均,藤川辰一郎,平野 賢一:
 軽金属,29 (1979),322.
- 6)根本 実,幸田 成康:日本金属学会誌, 29 (196 5), 399.
- 7) 根本 実, 幸田 成:日本金属学会誌, 29 (1965), 406.
- 8) 吉田 冬樹, 菅元 淳二, 中島 英治, 吉永 日出男:日本金属学会誌, 58 (1994), 613.

9)田代 均,藤川辰一郎,平野 賢一:軽金属,29

(1979), 377.

10) 呂 満珊,後藤 正治,麻生 節夫,小松 芳成,

89

劉 武:素材物性学雑誌,9(1996),30.

- 11) 宮川 英明, 中島 英治, 吉永日出男:日本金属学 会誌, 57 (1993), 36.
- 12) J. H. Schroder and E. Arzt : Scripta Met., 19 (1985), 112
- R. W. Weeks, S. R. Pati, M. F. Ashby and P. Barrand: Acta Met., 17 (1969), 1403.